PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2988 di lunedì 10 dicembre 2012

INAIL: nanotecnologia sicura negli ambienti di lavoro

Una introduzione per Datori di Lavoro, Direttori, Lavoratori e Professionisti della Salute e Sicurezza: sono pericolose le nanoparticelle? Come possono essere esposti i lavoratori? Può essere misurata e controllata l'esposizione?

La formazione dei lavoratori dovrebbe essere parte di un programma completo sulla salute e sicurezza. Per ridurre l'esposizione a nanoparticelle, i lavoratori dovrebbero imparare la corretta manipolazione delle nanoparticelle, l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale, la corretta gestione degli indumenti di lavoro, come anche la pulizia delle superfici contaminate e lo smaltimento dei nanomateriali.

L'INAIL mette a disposizione un l'opuscolo "Nanotecnologia sicura negli ambienti di lavoro": una introduzione per Datori di Lavoro, Direttori, Lavoratori e Professionisti della Salute e Sicurezza.

La nanotecnologia consiste nella progettazione e manipolazione di materiali a livello molecolare. Questa nuova tecnologia crea materiali con dimensioni variabili da 1 a 100 nanometri (1 nanometro è 1 miliardesimo di metro). Le particelle create in scala nanometrica presentano proprietà chimiche e fisiche differenti da quelle particelle più grandi dello stesso materiale. Queste nano particelle costruite sono conosciute come *nano particelle ingegnerizzate (In questo opuscolo per nanoparticelle si intendono nano particelle Ingegnerizzate)*. Scienziati e produttori possono utilizzare le nanoparticelle per creare nuovi prodotti, impossibili da realizzare con quelle più grandi.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20006] ?#>

Questo opuscolo affronta le seguenti questioni:
1. Sono pericolose le nanoparticelle per i lavoratori?
2. Come possono essere esposti i lavoratori?
3. Può essere misurata l'esposizione a nanoparticelle?
4. Può essere controllata l'esposizione dei lavoratori?

Inail - " Nanotecnologia sicura negli ambienti di lavoro" (formato PDF, 680 kB)

RPS

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.